



PCT/EP 0 0 / 0 3 7 4 5



INVESTOR IN PEOPLE

The Patent Office
Concept House
Cardiff Road
Newport
South Wales
NP10 8QQ

REC'D 28 JUL 2000

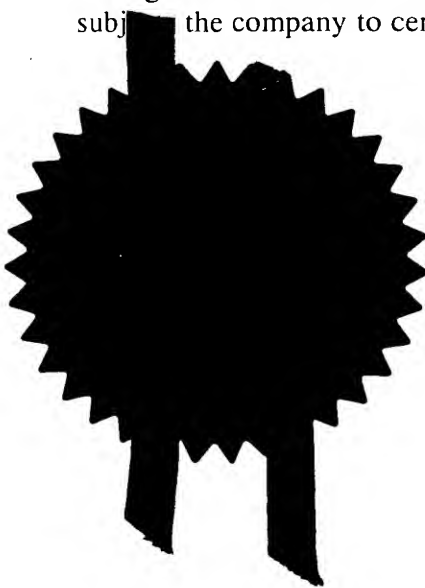
WIPO PCT

I, the undersigned, being an officer duly authorised in accordance with Section 74(1) and (4) of the Deregulation & Contracting Out Act 1994, to sign and issue certificates on behalf of the Comptroller-General, hereby certify that annexed hereto is a true copy of the documents as originally filed in connection with the patent application identified therein.

In accordance with the Patents (Companies Re-registration) Rules 1982, if a company named in this certificate and any accompanying documents has re-registered under the Companies Act 1980 with the same name as that with which it was registered immediately before re-registration save for the substitution as, or inclusion as, the last part of the name of the words "public limited company" or their equivalents in Welsh, references to the name of the company in this certificate and any accompanying documents shall be treated as references to the name with which it is so re-registered.

In accordance with the rules, the words "public limited company" may be replaced by p.l.c., plc, P.L.C. or PLC.

Re-registration under the Companies Act does not constitute a new legal entity but merely subjects the company to certain additional company law rules.



Signed

Dated 17th May, 2000.

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
R111 F 17 (a) OR (b)



Patents Form 1/77

Patent 77
(Rule 77)The
Patent
Office

CT/EP 00/03745

1/77

Request for grant of a patent

(See the notes on the back of this form. You can also get an explanatory leaflet from the Patent Office to help you fill in this form.)

The Patent Office

Cardiff Road
Newport
Gwent NP9 1RH

1. Your reference

C783/S

2. Patent application number

(The Patent Office will fill in this part)

9927612.3

23 NOV 1999

3. Full name, address and postcode of the or of each applicant (underline all surnames)

Schlumberger Limited
5 Julianaplein
Curacao
Netherlands Antilles

Patents ADP number (if you know it)

If the applicant is a corporate body, give the country/state of its incorporation

041893/2004

4. Title of the invention

Radiation Source

5. Name of your agent (if you have one)

"Address for service" in the United Kingdom
to which all correspondence should be sent
(including the postcode)

Keith W Nash & Co
90-92 Regent Street
Cambridge
CB2 1DP

Patents ADP number (if you know it)

1206001 ✓

6. You are declaring priority from one or more earlier patent applications, give the country and the date of filing of the or of each of these earlier applications and (if you know it) the or each application number

Country

Priority application number
(if you know it)Date of filing
(day / month / year)

7. If this application is divided or otherwise derived from an earlier UK application, give the number and the filing date of the earlier application

Number of earlier application

Date of filing
(day / month / year)

8. Is a statement of inventorship and of right to grant of a patent required in support of this request? (Answer 'Yes' if:

a) any applicant named in part 3 is not an inventor, or
b) there is an inventor who is not named as an applicant, or

a) yes

c) any named applicant is a corporate body.
See note (d))

Patents Form 1/77

Patents Form 1/77

9. Enter the number of sheets for any of the following items you are filing with this form. Do not count copies of the same document

Continuation sheets of this form

Description 17

Claim(s) 3

Abstract 1

Drawing(s) 4

10. If you are also filing any of the following, state how many against each item.

Priority documents

Translations of priority documents

Statement of inventorship and right to grant of a patent (Patents Form 7/77)

Request for preliminary examination and search (Patents Form 9/77)

Request for substantive examination (Patents Form 10/77)

Any other documents (please specify)

11.

I/We request the grant of a patent on the basis of this application.

Signature Keith W Nash - Date 23.11.99
Keith W Nash & Co, Agents

12. Name and daytime telephone number of person to contact in the United Kingdom

Mr D L Roberts 01223 355477

Warning

After an application for a patent has been filed, the Comptroller of the Patent Office will consider whether publication or communication of the invention should be prohibited or restricted under Section 22 of the Patents Act 1977. You will be informed if it is necessary to prohibit or restrict your invention in this way. Furthermore, if you live in the United Kingdom, Section 23 of the Patents Act 1977 stops you from applying for a patent abroad without first getting written permission from the Patent Office unless an application has been filed at least 6 weeks beforehand in the United Kingdom for a patent for the same invention and either no direction prohibiting publication or communication has been given, or any such direction has been revoked.

Notes

- If you need help to fill in this form or you have any questions, please contact the Patent Office on 0645 500505.
 - Write your answers in capital letters using black ink or you may type them.
 - If there is not enough space for all the relevant details on any part of this form, please continue on a separate sheet of paper and write "see continuation sheet" in the relevant part(s). Any continuation sheet should be attached to this form.
 - If you have answered 'Yes' Patents Form 7/77 will need to be filed.
 - Once you have filled in the form you must remember to sign and date it.
- For details of the fee and ways to pay please contact the Patent Office.

C783.00/S

Title: Radiation Source

Field of the Invention

This invention relates to a radiation source and in particular to a radiation source incorporating semiconductor material and capable of emitting infrared (IR) radiation.

Background to the Invention

Radiation sources made from semiconductor material are available which emit IR radiation from an active area consisting of A^3B^5 material and a p-n junction. The source is constructed on the basis of an n-InGaAs/p-InGaAs/n-InAs heterostructure and emits radiation of a wavelength in the range 2.5-4 μ m. Typically such sources are used to measure the transmittance of a gas mixture in the hydrocarbon absorption band area of 3.3 μ m. Such sources have a long lifetime (more than 30,000 hours) and a narrow spectrum of radiation (less than 0.4 μ m), both of which allow these sources to be used in gas analysis equipment. However, these sources cannot work at temperatures above 80°C. Furthermore, these sources (sources with narrow band substrate) have top wire bonding, as a result of which it is difficult to incorporate them with fibres.

Other semiconductor sources of IR radiation are known which emit radiation in the near IR spectral range of the spectrum, i.e. around 1-2.5 μ m, and are able to work at increased temperatures. However, the emitted wavelength is of limited usefulness.

The present invention aims to provide an improved radiation source for emission of IR radiation.

Summary of the Invention

According to one aspect of the present invention, there is provided a radiation source comprising a first active layer coupled to a second active layer, wherein the first active layer produces primary radiation of frequency ν_1 by appropriate stimulation, and the primary radiation is converted by the second active layer to secondary radiation of frequency ν_2 for subsequent output. This two-step process allows the first active layer to emit at one frequency, with this frequency then being converted to a different frequency by the second active layer.

Additional active layers may be provided, such that each active layer is coupled to a previous active layer, and each active layer subsequent to the first active layer modifies the radiation produced by the previous active layer. In this way, the primary radiation may be modified as many times as necessary to produce output radiation of a desired frequency and/or to produce intermediate frequencies used for reference measurements.

Whilst the coupling of the first active layer to the second active layer may be achieved by affixing a surface of the first active layer to a surface of the second active layer, coupling may also be achieved by use of an intermediary layer disposed between the first active layer and the second active layer. The intermediary layer is preferably made of polymer compounds (epoxy) similar or close to those used for NIR LED encapsulation and paraffin's or liquids (suitable for construction of a source prototypes and investigations) or chalcogenic glasses. Both classes of intermediary layer have a variety of possible compositions, just to mention few glasses containing sulphur:

- 1) As_2S_3 ,
- 2) S(10-20%)-I(2-60%)-As(10-60%)-Sb(2-5%),
- 3) As(16-37%)-S(24-30%)-Te(20-41%)-Sb(2-23%),
- 4) As(16-38%)-Sb(2-18%)-S(20-30%)-Se(20-40%)-Br(4-17%).

These materials are substantially optically transparent to the primary radiation, so providing optical coupling between the first active layer and the second active layer, that is, to provide conditions for radiation from the first active layer to pass through the optical coupling layer to reach the second active layer without being modified in frequency and without strong reduction of intensity.

The intermediary layer preferably has a refractive index n which is less than or equal to the refractive index of the active layers positioned either side of the intermediary layer.

The first active layer may comprise a semiconductor junction, and thus the radiation source may further comprise an injection region incorporated in the first active layer, where injection of electrical carriers into the first active layer from the injection region stimulates the first active layer to emit the primary radiation. The injection region may be provided by a p-n junction, with appropriate electrical biasing.

The first active layer preferably has a direct band gap energy associated with the material from which it is made, with the second active layer being associated with a second band gap energy, the first band gap energy being much greater than the second band gap energy.

Desirably, the first active layer has a band gap energy in the range of 0.6 to 1.5 eV where the highest radiation efficiencies are available now for spontaneous and stimulated light sources (up to 30-50%). Using a wide band gap energy for the first active layer increases the efficiency of injection associated with the injection region, or p-n junction, at high temperatures.

First active layer may produce spontaneous or stimulated emission and may be thus surrounded by confinement layers to create waveguide effect or by multilayer structure to create VCSEL.

The second active layer may also contain several sublayers to provide suitable electron confinement of photopumped nonequilibrium carriers. Together with active layer they may form structures with one or more heterojunctions, e.g. quantum dot structures, double heterostructure or superlattice with active layer thickness in the range of 10 nm to 10 μm or up to 100 μm for graded band gap layers, and desirably the active layers satisfy the following conditions:

- (1) $h\nu_{\text{max}} \leq E_{\text{subsequent}} + E_f * k < E_{\text{previous}}$
- (2) $1/\alpha_{\text{entry}} \leq d \leq 1/\alpha_{\text{exit}}$

where $h\nu_{\max}$ is the maximum energy for the recombined radiation spectrum in the subsequent additional active area, optically connected with the previous active layer;

E_{previous} is the band gap energy of the previous active layer optically connected with the present one;

$E_{\text{subsequent}}$, E_f are the band gap energy and the Fermi energy level of the subsequent optically connected additional active layer, respectively;

d is the thickness of the subsequent optically connected additional active layer;

α_{entry} and α_{exit} are the effective absorption coefficients for the radiation entering and exiting the subsequent additional active layer, respectively.

As the active layers are separate, yet coupled together, the materials of the respective active layers can readily be selected to have different characteristics, such as different band gap energies. Thus when using a first active layer and a second active layer, the material of the second active layer is desirably selected to respond to the primary radiation so as to produce a secondary radiation of frequency in the middle infra-red range.

Thus desirably the second active layer has a band gap energy of 0.1 to 0.6 eV.

Preferably the first active layer is made of A^3B^5 material and/or its solid solutions, with appropriate dopants used where necessary. The examples are GaAs, InP, GaP, InGaAs, InGaAsP with Zn, Mn, Mg, Be as a p-type dopants and Sn, Te as a n-type dopants.

The second active layer is preferably made of GaSb, InAs, InSb and solid solutions made from these compounds and their combinations (heterostructures, superlattices and quantum dot structures) so as to produce an energy gap in the material which results in production of a secondary radiation having a frequency in the middle IR range during recombination. The second layer may be also doped to obtain desired emission efficiency and frequency. Doping is useful for the narrow gap materials such as InAs, InSb and their solid solutions since they have small density of states in a conduction band and therefore strong degeneration of the

band at reasonably low donor concentrations ($n \sim 10^{18} \text{ cm}^{-3}$). Thus emission at energies higher than energy gap can be easily achieved due to the Moss-Burshtein effect.

Preferred materials for the active layers include $\text{InAs}_{1-x}\text{Sb}_x\text{P}_y$ and $\text{In}_{1-v}\text{Ga}_v\text{As}_{1-w}\text{Sb}_w$ where $x+y < 1$, $w < 1$ and $v < 1$. The composition of these materials preferably varies over a given thickness, so as to produce a graded variation in the band gap energy across the material. Thus typically a narrow band gap energy will exist at one edge of an active layer made from the graded material, with a wider band gap energy existing at the other edge. These graded materials preferably possess the radial symmetry of a unit cell.

Where the radiation source comprises at least one active layer made from a graded material, preferably the edge of the graded material with the narrow band gap energy adjoins the injection region. The second active layer may contain additional layer(s) (or cap(s)) with energy gap larger than the gap in the main absorbing layer to produce the "window effect" for the light generated during the $h\nu_1 \rightarrow h\nu_2$ phototransition process. The examples are *InAsSbP/In(Ga)As(Sb)/InAsSbP*, *InAs/InAsSb/InAs*, $n^+ \text{-InAs/InAsSb/n}^+ \text{-InAs}$, *GaSb/InAsSb/GaSb*, *InP/InGaAs/InP* double heterostructures and *InP/InAsP*, *InAs/InAsSb(Ga)*, *GaSb/InAsSb(Ga)*, $n^+ \text{-InAs/n}^+ \text{-In(Ga)As}$, $n^+ \text{-InAs/n}^+ \text{-InAs}$, $n^+ \text{-InSb/n}^+ \text{-InSb}$, heterostructures where *CAPS* are marked in *ITALIC*, and narrow gap active layers marked as underlined.

The radiation source may contain coating contacting active layer or active layer cap which reduce internal reflection losses. The preferred materials are abovementioned chalcogenic glasses and polymer compounds. The coating may form Veershtass sphere to form narrow far field pattern.

The radiation source may be a device incorporating a p-n junction, such as a light emitting diode.

It is believed that the invention overcomes the problem of temperature quenching associated with known sources of providing an LED with separated injection and recombination areas and dividing these areas, that is, creating the possibility of injecting in

6

one material (say with $E_g=1.4$ eV) and recombining in the middle IR range in another material (say with $E_g=0.25$ eV), greatly increased efficiency of injection at high temperatures.

In that connection, several structures with the broad band p-n emitter area and narrow band active area made from InAs(Sb), In(Ga)As(Sb), InAsSbP -alloys with peak emission at $\lambda=4.1, 3.7,$ and $3.3\mu\text{m}$ (300 K) respectively have been fabricated and studied with respect to high temperature gas sensing.

The invention will now be described by way of example, and with reference to the accompanying drawings in which:

Figure 1 is a schematic view of the radiation source in accordance with the present invention;

Figure 2 is a sectional view through a semiconductor device in accordance with the present invention;

Figure 3 is a sectional view through a second embodiment of a semiconductor device in accordance with the present invention and

Figure 4 is a sectional view through a third embodiment of a semiconductor device in accordance with the present invention

Description

In Figure 1, a schematic view of a radiation source in accordance with the present invention is shown. The device 10 comprises a first active area or layer 12 and a second active layer 14. Injection of electric charge carriers, such as electrons and holes, occurs in the first active layer 12, with recombination of carriers occurring in the second active layer 14 to produce an emitted radiation of a frequency which results in a wavelength in the middle IR spectrum, i.e. around $3-7\mu\text{m}$. The device has a layered structure with the first active layer 12 supported on a holder or base 16, to which electrical connections are made. A p-n junction 20 is

supported on the uppermost surface of layer 12 and the second active layer 14 supported on the uppermost surface of the p-n junction 20.

In such a radiation source, the injection area and recombination area are divided, instead of being positioned in a single p-n or hetero-p-n structure. This allows the material for the recombination area to be selected independently of the material used for the injection area, and so permits selection of materials having the most appropriate characteristics for the respective areas. Thus by dividing these areas, injection can occur in one type of material, with a band gap energy of, for example, $E_g=1.4\text{eV}$ and recombination occur in another type of material with, for example, $E_g=0.25\text{eV}$. This allows the recombination material to be selected to produce emitted radiation in the middle IR range, without affecting the selection of the injector (p-n junction) material.

If desired, an optical coupling layer can be placed between the p-n junction 20 and the second active layer 14, such that the second layer 14 interacts with the first layer 12 via the intermediate optical coupling layer.

An embodiment of a semiconductor optoelectronic device incorporating the generalised features explained with reference to Figure 1 is shown in Figure 2. Semiconductor optoelectronic devices, and specifically those which act as sources of infrared (IR) radiation, can be used in gas analysis devices, spectrometers, and detector and communication systems.

The device of Figure 2 comprises a plurality of different layers with appropriate electrical connections to enable it to function as a radiation emitter. Thus the device 30 comprises a holder 32 including electrical connections 34, 36 and 38, with an emitter layer 40 placed above the surface of the contacts 34, 36 and 38. A first active layer 42 made of a direct band-gap material is affixed onto the emitter layer 40 and above this first active layer a cladding layer 44 is deposited to form electrical confinement. The first active layer 42 incorporates a p-n junction 48 where injection of carriers occurs indicated as a flow of electrons ($\downarrow e$) and holes ($\uparrow h$). The layers 40, 42 and 44 are arranged such that they form a

well for the injected carriers. The p-n junction lies within a well or at heterojunctions 40/42 or 42/44. The active injection area is thus limited to an isolated area within the first active layer 42, above the electrical contact 36. This results in the emitted radiation from the first active layer 42 being produced as substantially a cone of radiation.

Above the cladding layer 44, a substrate 54 is deposited through which primary radiation at a first frequency emitted by the first active layer 42 passes. An optical compound 58 adjoins the uppermost surface 60 of the substrate 54 and provides optical coupling between the first active layer 42 and a second active layer 62 placed on the uppermost surface of the optical compound 58. The uppermost surface of second layer is also known as the wide-gap surface of the graded-material, with surface 66 representing the narrow-gap surface of the graded material.

Instead of providing the optical compound 58 as a coupling link between the two layers, the layers can be affixed together by adhesive or a suitable cement.

The p-n junction is subjected to forward bias, which causes the carriers to be injected into the first active area 42. The carriers injected recombine, with emission of radiation in the near IR spectral range with energy $h\nu \cong E_{\text{previous}}$. The quanta thus formed leave the first active area at frequency ν_1 and fall into the subsequent additional(second) active layer 62, optically connected with the first, where they are absorbed near to the surface 66. As a result, minor photoexcited carriers are formed in the second area 62, and in their turn recombine with energy close to $E_{\text{subsequent}} + E_f * k$, where $k = 0$ for non-degenerated material and $k = 1$ for degenerated. The quanta thus produced, which have a frequency ν_2 corresponding to the middle IR spectral range, leave the additional active area 62 and create an output radiation suitable for practical application.

The separation of the first and second active layers as shown in the devices of Figures 1 and 2 allows different materials to be selected for injection in the first layer, and recombination in the second layer.

Typically, the active layers comprise semiconductors from groups III and V of the periodic table, with different A^3B^3 materials and/or their solid solutions used for the different active layers, so that the active layers can be selected to have different band gap energies. Using III-V based emitters ensures there is sufficient thermal conductivity in the different layers for thermal stability and also that the device has stability against moisture.

By having separate active layers for injection and recombination, the final emitted wavelength of the source can be chosen from a wide range, and producing such devices is simplified as relatively thick layers of doped semiconductor material can be used when forming the device. It is possible to use a cascade of active layers made from different materials to produce an output radiation with a desired wavelength, and thus 3, 4, 5 or a plurality of active layers can be used in sequence within a device to achieve a particular output radiation.

The device of Figure 3 has many features similar to those of the embodiment shown in Figure 2 and such features are denoted by the corresponding reference numerals used in Figure 2. The device shown in Figure 3 comprises a plurality of different layers with appropriate electrical connections to enable it to function as a radiation emitter. Thus the device comprises four active layers : 42 (first layer) and 62, 70, 71(subsequent layers). Active layer 62 emitting at frequency $h\nu_2$ comprises double heterostructure with cladding layers 67, 68. The purpose of the claddings is to accumulate photopumped carriers in active layer far from the surface where high nonradiative recombination which is normally found in III-V narrow band semiconductors.

Layer 70 has energy gap which differs from that of layer 62 thus producing radiation with second frequency $h\nu_3 \neq h\nu_2$.

The uppermost surfaces of layers 62, 70 are coated by glass or compound 69 having refractive index smaller than that of 62 or/and 70 layer materials. The purpose of the coating 69 is to decrease reflection losses of $h\nu_2$, $h\nu_3$ radiation exiting the layers 62 and 70 correspondingly. The shape of the coating may be made in a such a way as to collimate radiation exiting the light source (e.g. with Veerschtrasse sphere).

The active layer 71 is placed on top of the coating 69 in order to make optical connection to the radiation $h\nu_2$, $h\nu_3$ which passes through coating 69. The $h\nu_2$ or/and $h\nu_3$ radiation is absorbed in the subsequent active layer 71 with subsequent emission at $h\nu_4$ frequency.

By using an injector (p-n junction) material with a wide energy band gap, the efficiency of injection at high temperatures is greatly increased. The apparent inefficiency caused by additional phototransformation of quanta formed in the first active layer 42 and radiated in the subsequent optically connected active layer 62 by the absorption and recombination process $h\nu_1 \rightarrow h\nu_2$, is overcome by the gain in efficiency of injection. Moreover, in most narrow band semiconductor light sources due to high electron mobility the recombination occurs in the p-type side of a p-n junction. However, p-InAs and related compositions (InAs(Sb), In(Ga)As, InAs(P), ...) suffer from strong Auger recombination and thus low quantum efficiency at room temperature is expected. Therefore creation of a separate active layer (first and second active layers may be fabricated separately) permits to make any desired layer doping procedure (including n-type doping or/and rare earth gettering) without reference to parameters governed by technological process of p-n junction creation in the narrow band material. The obtained freedom in the choice of active layer parameters permits thus to design source to work effectively in the middle IR spectral range at high temperatures, and be simple and cheap to construct. The band gap energy and the thickness of each subsequent active layer relative to the previous active layer satisfy the correlations:

$$h\nu_{\max} \leq E_{\text{subsequent}} + E_f * k < E_{\text{previous}}$$
$$1/\alpha_{\text{entry}} \leq d \leq 1/\alpha_{\text{exit}}$$

where $h\nu_{\max}$ is the maximum energy for the recombined radiation spectrum in the subsequent additional active area, optically connected with the previous active layer;

E_{previous} is the band gap energy of the previous active layer optically connected with the present one;

$E_{\text{subsequent}}$, E_f are the band gap energy and the Fermi energy level of the subsequent optically connected additional active layer, respectively;

d is the thickness of the subsequent optically connected additional active layer. Typical thickness range is from 10 nm to 10 μm or up to 100 μm for the graded crystals

α_{entry} and α_{exit} are the effective absorption coefficients for the radiation entering and exiting the subsequent additional active layer, respectively (typically $\alpha_{\text{entry}} = 5 \cdot 10^3 - 10^5 \text{ cm}^{-1}$, $\alpha_{\text{exit}} = 5 \cdot 10^2 - 10^4 \text{ cm}^{-1}$);

and there is, between two active layers, at least one layer of a substance with a refractive index of n which optically couples the two layers and which satisfies the correlation:

$$1 < n \leq n_{\text{previous, subsequent}}$$

where $n_{\text{previous, subsequent}}$ are the refractive indices for the previous and subsequent active layers, respectively.

Introducing additional active layers, optically connected with the first and consisting of A^3B^5 material and/or its solid solutions, into the device structure, with an energy band gap that satisfies the specified correlations, and with the space (gap) between the active areas filled with a substance with a refractive index n , which satisfies the conditions $1 < n \leq n_{\text{previous, subsequent}}$ leads to the creation of a p-n junction (injector) in the material with a wide band gap. This greatly increases the efficiency of injection at high temperatures and also reduces the loss of radiation output received in the middle IR area at high temperatures, in so far as the angle of full internal reflection is increased at the edge of the previous and subsequent optically connected active areas. This leads to an increase in the source's efficiency.

The introduction into a device such as an LED of a second active layer, optically connected with a previous active layer and consisting of A^3B^5 material and/or its solid solutions, creates the possibility of transforming the wavelength of the radiation exiting from the previous optically connected active area in a given wavelength range. A^3B^5 materials are preferred as they have a high absorption coefficient and a high internal quantum yield value. The application of other substances (for example, A^2B^6) is generally ineffective, because their quantum yield is not great and they are less stable, especially at high temperatures and in moist atmospheres. The choice of energy band gap for the additional active area (taking into

account $k = 0$) for non-degenerated material and $k = 1$ for degenerated) allows the radiation exiting from the previous optically connected active area to be absorbed.

Failure to fulfil the condition $E_{\text{subsequent}} + E_f \cdot k < E_{\text{previous}}$ leads to an absence of photoexcitation of the carriers in the second active layer, because of the sharp drop in the absorption coefficient at energy levels below $E_{\text{subsequent}} + E_f \cdot k$. The intended application of the source, and the emitted radiation wavelength required, determines the $h\nu_{\text{max}}$ value. For sources used in gas analysers, the $h\nu_{\text{max}}$ value usually coincides with the absorption band of substances analysed. The $h\nu_{\text{max}}$ parameter must agree with the width of the forbidden band in the additional optically connected active area, that is, $h\nu_{\text{max}} \leq E_{\text{subsequent}} + E_f \cdot k$.

Fulfillment of the condition $d \geq 1/\alpha_{\text{em}}y$ ensures that most of the radiation exiting from the previous optically connected active layer will be absorbed. When $d < 1/\alpha_{\text{em}}y$ in the additional active layer, approximately $2/3^{\text{rd}}$ less of the overall flow from the near IR radiation will be absorbed ($I = I_0 \exp(-\alpha d)$); this leads to

a reduction in the efficiency of the transformation (output) of radiation and renders it impossible to use the source in practice. The condition $d \leq 1/\alpha_{\text{ext}}$ must be fulfilled for the radiation from the middle IR range to be emitted effectively from the second active layer. If this condition is not fulfilled, much of the radiation will be reabsorbed in the second active layer, so reducing the intensity of the radiation emitted.

By making the first and second active layers of graded band gap A^3B^5 materials and/or their solid solutions, a range of sources with different emitted wavelengths can be provided as the growth of layers allows material with the required energy band gap to be produced. The narrow-gap active layer material is typically graded InAsSb(P) compositions which are lattice mismatched with an InAs substrate, and have high quality and high quantum efficiency.

These graded layers can be produced with the radial symmetry of a unit cell using the LPE growth method to produce epilayers having low dislocation density and plastically deformed substrates with high dislocation density.

When the narrow-band gap surface is placed adjacent to the p-n junction, the effective absorption coefficient α_{ext} is sharply reduced, since the wide-gap areas of graded band gap material produce a 'window' effect for the radiation formed in the narrow-gap part. The α_{ext} calculation for the graded band gap material is set out in A.Berg & P.Din, "Light Emitting Diodes", "Mir", Moscow, 1979, p578, and N.P. Esina et al, Sov Phys Semicond, Vol. 15(1981), No 12, pp1372-4. In this way it becomes possible to use sufficiently thick layers (about 20-60 μm , $\forall E_g = 2-30 \text{ meV}/\mu\text{m}$), which, given the fragility of the A^3B^5 materials, makes the technological process of producing the devices simpler. Positioning the narrow-gap surface adjacent to the exiting radiation side (that is, positioning the wide-gap surface adjacent to the p-n junction) leads to a significant reduction in the source's efficiency because of the absorption of exiting light.

Examples of implementations of the device depicted in Figure 2 are now discussed below.

Example 1

The device in this example was produced by growing layers using the method of liquid-phase epitaxy (LPE) on a n^+ -InP (Sn) substrate oriented in (100) plane. Firstly a layer of undoped n -InGaAsP with $E_g = 1.19 \text{ eV}$ and thickness of $d \sim 1.0 \mu\text{m}$ was grown and this followed by a layer of undoped n -InGaAsP ($E_g = 1.01 \text{ eV}$, $d \sim 0.4 \mu\text{m}$), and then a layer of p^+ -InGaAsP, doped with Zn ($E_g = 1.01 \text{ eV}$, $d \sim 4.7 \mu\text{m}$). The composition of the second layer was optimized for receiving radiation in the range of 1.21-1.23 μm at room temperature. The epitaxial structure was cleaved into rectangular chips $1 \times 1 \times 0.35 \text{ mm}^3$ in size, which were soldered with indium on a standard TO-18 holder with the p-layer downwards. The n-contact was made of indium on an InP surface, so that the free InP surface was $1 \times 0.9 \text{ mm}^2$ in size. For the second layer, indium arsenide of 2-4 μm thickness was used, with n -type conductivity where $n = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. The layer was fastened to the n^+ -InP (Sn) surface by point soldering with indium. The source thus produced was supplied with continuous current at 30mA and radiated at a wavelength of 3.5 μm with a radiation spectrum half-width of 0.4 μm . The radiation was recorded up to and including a temperature of 130°C, at which the spectrum peaked at 3.6 μm .

Example 2

In the device according to Example 2, the epitaxial structure for the first active area is identical to that described in Example 1. Using standard photolithographical methods, a deep mesa 400 μm in diameter was created on the epitaxial structure, and an ohmic contact (Cr + Au) 260 μm in diameter was formed by vacuum sputtering. The contact with the n-area (Cr + Au) was horseshoe-shaped and was sputtered both onto the p-area outside the mesa and onto the n-area on the slopes of the outer mesa. The contacts were then strengthened by additional precipitation of galvanic gold. The crystals with the mesa structures and contacts were cut into rectangular chips of dimensions 0.3 x 0.9 x 1 mm³ and mounted onto a carrier (submount) of semi-insulating silicon of dimensions 0.4 x 1.5 x 1.7 mm³ with contact areas of Sn + Pb. The narrow-gap active area was created as follows. On the indium arsenide substrate, a gradient layer of InAsSbP was grown, 60 μm thick, with an InAs_{0.92}Sb_{0.08} compound on the surface and an increase in phosphorus content towards the substrate, with a band gap gradient of 1-2 meV/ μm . After the growth process, the InAs substrate was chemically etched off, leading to a final thickness for the layer of 20 μm . The gradient layer achieved was fixed by spot soldering the narrow-zone surface to the InP sublayer using indium. The emitter produced using the above method radiated at a wavelength of 4.2 μm near the carbon dioxide absorption band and showed a stable performance up to and including 90°C.

Example 3

The radiation source was produced as described in Example 2. However, the gap between the InP substrate and the InAsSbP layer was filled with an optical polymer compound (epoxy), transparent in the near IR region. The radiation output of the source was 2-3 times higher than in Example 2.

Example 4

The radiation source was produced as described in Example 2. However, the first active layer was made of GaAs sandwiched between GaAlAs claddings. Several mesas have been made on a pumping LED chip all being bonded p-side down to the Si carrier (submount). The top of GaAs LED was covered by heterostructure consisting of 70 μm thick n-InAs

substrate (cap) and 1.5 μm thick $\text{InAs}_{0.92}\text{Sb}_{0.08}$ active layer deposited onto InAs by LPE method. The heterostructure was cemented to GaAs LED surface by a As(16-38%)-Sb(2-18%)-S(20-30%)-Se(20-40%)-Br(4-17%) glass. The same glass was deposited onto the n-InAs cap. The radiation output of the source was 2-3 times higher than in Example 3.

Example 5

This radiation source was generally produced as described in Example 1. However the second active layer was composed of 70 μm thick n-InAs ($n=2 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, cap) and 1.5 μm thick Gd doped n-InAs ($n < 2 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$) active layer deposited onto InAs by LPE method. The radiation output of the source was 2-3 times higher than in Example 1.

Example 6

This radiation source was generally produced as described in Example 1. However the second active area was positioned perpendicular to the p-n junction and parallel to (011) crystal plane. The p-n junction was supplied with short impulses (less than 1 μs) with a range of current of 7A. The radiation output was higher than with the methods mentioned above, and higher than Example 2, because the first active area began working in a stimulated regime.

Example 7

The source was produced as described in Example 3, however the InAsSbP layer area was half the size, and the freed area on the InP surface was covered with an InAs layer, identical to those described in Example 1, so as to create a third active layer. The source produced radiated simultaneously in two wavelengths: 4.2 μm and 3.5 μm .

Example 8

The first active area and the p-n junction were produced as in the previous examples. Second and third active layers, consisting of gradient layers of $\text{InAs}_{1-x-y}\text{Sb}_x\text{P}_y$ and $\text{In}_{1-v}\text{Ga}_v\text{As}_{1-v}\text{Sb}_v$ were placed on the InP surface with compositions on the narrow-zone surface: $x = 0.2$, $y = 0$, $v = 0.1$. The faces of the second and third active areas were rectangular in shape and were firmly joined to each other along the line that divided the InP surface into two equal

parts as normal. When voltage was applied to the p-n junction, the source radiated on two wavelengths: 5.5 μm and 3.9 μm , which corresponded to the phototransformation in the respective second and third active layers. Similar two- and multi-wave sources may be used in optical gas analysers with several measurement channels.

Example 9

This source had the same component parts as in Example 5, however the second and third active layers were positioned in sequence according to ray movements. The second active layer of InGaAsSb layer was joined to the InP using a compound, and the third active layer of InAsSbP was placed 10mm away from the InGaAsSb. This positioning of the areas allowed the production of a ray with a consistently changing wavelength (3.8-5.5 μm), suitable for use in spectroscopy.

Example 10

The source was produced as described in Example 1, however the second active layer was composed of n⁺-InSb/n-InSb structure fabricated by LPE method. The 2 μm thick n-InSb active area adjoined the InP LED top layer through the As(16-37%)-S(24-30%)-Te(20-41%)-Sb(2-23%) glass (72). The source emitted at 6 μm (300K). To couple the source with As₂S₃ fibre (73) the latter was glued by the glass mentioned in Example 4 as shown in Fig.4, in which elements corresponding to those of Figures 1 and 2 are denoted by the corresponding reference numerals in Figures 1 and 2.

Example 11

The source was produced as described in Example 1, however the second active layer was composed of InAsP/InP structure with the increase of phosphorus content towards InP substrate. The 15 μm thick graded n-InAsP active area fabricated by LPE method adjoined the InP LED top layer through the As(16-37%)-S(24-30%)-Te(20-41%)-Sb(2-23%) glass. The source emitted at 2.1 μm with FWHM of about 0.3 μm at room temperature.

Preliminary evaluation shows that InAsSb-based 'radial symmetry' LEDs will be very stable with a narrow emission band (FWHM<600nm), high output power (over 50 000 nW) and will be several times cheaper. Thus these LEDs will enable to decrease the limit of detection

by factor 2-4 since most gases (NO is an example) have narrow absorption bandwidth (FWHM~200 nm).

Thus the invention allows the creation of reliable and effective ambient operating light emitting diodes (LEDs) which emit in the 3000 to 6500 nm spectral range and which can be used as light sources for infrared analysers including the fibre optic ones. The spectral range for the source operation can be extended to 8000-14000 nm range by appropriate choice of the second layer composition and layer arrangement.

C783.00/S

Claims

1. A radiation source comprising a first active layer coupled to a second active layer, wherein the first active layer produces primary radiation of frequency ν_1 by appropriate stimulation, and the primary radiation is converted by the second active layer to secondary radiation of frequency ν_2 for subsequent output.
2. A radiation source according to claim 1, wherein additional active layers are provided, such that each active layer is coupled to a previous active layer, and each active layer subsequent to the first active layer modifies the radiation produced by the previous active layer.
3. A radiation source according to claim 1 or claim 2, wherein coupling occurs by an intermediary layer disposed between the first active layer and the second active layer.
4. A radiation source according to claim 3, wherein the intermediary layer is substantially optically transparent to the primary radiation, so providing optical coupling between the first active layer and the second active layer.
5. A radiation source according to claim 3 or claim 4, wherein the intermediary layer has a refractive index n which is less than 1, and less than or equal to the refractive index of the active layers positioned either side of the intermediary layer.
6. A radiation source according to any of the preceding claims, wherein the first active layer comprises a semiconductor junction.
7. A radiation source according to any of the preceding claims, wherein the radiation source further comprises an injection region incorporated in the first active layer, where injection of electrical carriers into the first active layer from the injection region stimulates the first active layer to emit the primary radiation.

8. A radiation source according to claim 7, wherein the injection region is a p-n junction.
9. A radiation source according to any of the preceding claims, wherein a first band gap energy is associated with the first active layer, and a second band gap energy is associated with the second active layer, the first band gap energy being much greater than the second band gap energy.
10. A radiation source according to any of the preceding claims, wherein the active layers satisfy the following conditions:

- (1) $h\nu_{\max} \leq E_{\text{subsequent}} + E_f * k < E_{\text{previous}}$
- (2) $1/\alpha_{\text{entry}} \leq d \leq 1/\alpha_{\text{exit}}$

where $h\nu_{\max}$ is the maximum energy for the radiation reduced in a subsequent active layer optically connected with a previous active layer;

E_{previous} is the band gap energy of the previous active layer;

$E_{\text{subsequent}}$, E_f are the band gap energy and the Fermi energy level of the active layer, respectively;

d is the thickness of the subsequent active layer;

α_{entry} and α_{exit} are the effective absorption coefficients for the radiation entering and exiting the subsequent active layer, respectively.

11. A radiation source according to any of the preceding claims, wherein the active layers are made of A^3B^5 material and/or its solid solutions.

12. A radiation source according to claim 11, wherein at least one active layer comprises $\text{InAs}_{1-x-y}\text{Sb}_x\text{P}_y$, where $x+y < 1$.

13. A radiation source according to claim 11, wherein at least one active layer comprises $\text{In}_{1-u}\text{Ga}_v\text{As}_{1-w}\text{Sb}_w$, where $x+y < 1$, $w < 1$ and $v < 1$.

14. A radiation source according to any of the preceding claims, wherein the first active

layer and the second active layer are made from a material with a graded variation in band gap energy.

14. A radiation source according to claim 2, wherein the additional active layers are made from a material with a graded variation in the band gap energy.

16. A radiation source according to claims 14 or 15, wherein the material with a graded variation possesses the radial symmetry of a unit cell.

17. A radiation source according to claim 15 or 16, wherein the material with a graded variation adjoins the injection region along one edge where the material has a narrow band gap energy.

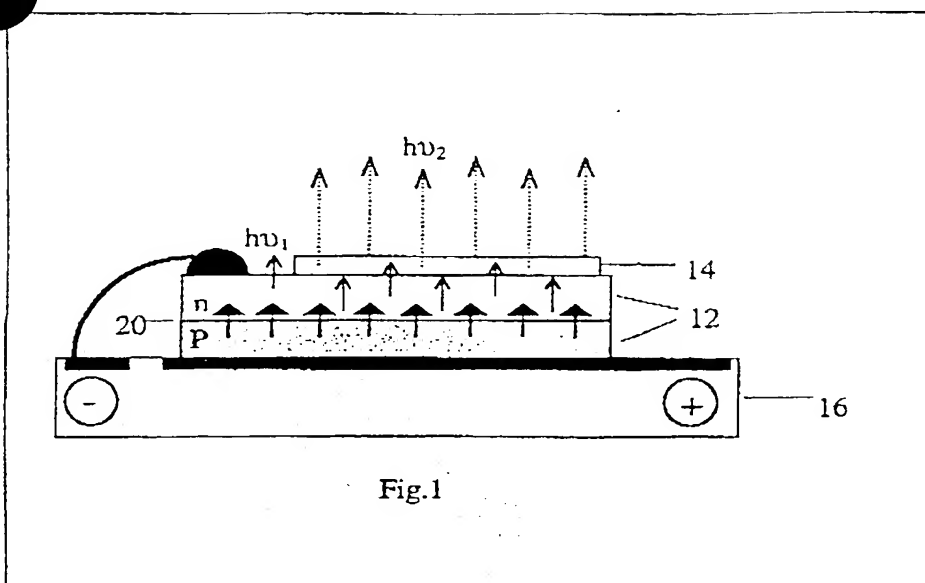
18. A radiation source according to claim 1, wherein the radiation source is a light emitting diode.

C783.00/S

AbstractTitle: Radiation source

A radiation source (10; 30) is provided comprising a first active layer (10) coupled to a second active layer (14), wherein the first active layer (12) produces primary radiation of frequency ν_1 by appropriate stimulation, and the primary radiation is converted by the second active layer (14) to secondary radiation of frequency ν_2 for subsequent output. The coupling between the first and second active layers is achieved by an intermediary layer (20) disposed between the first active layer (12) and the second active layer (14). The radiation source (30) further comprises a p-n junction (48) incorporated in the first active layer 42, where injection of electrical carriers into the first active layer (42) from the p-n junction stimulates the first active layer (42) to emit the primary radiation.

[Figure 2]



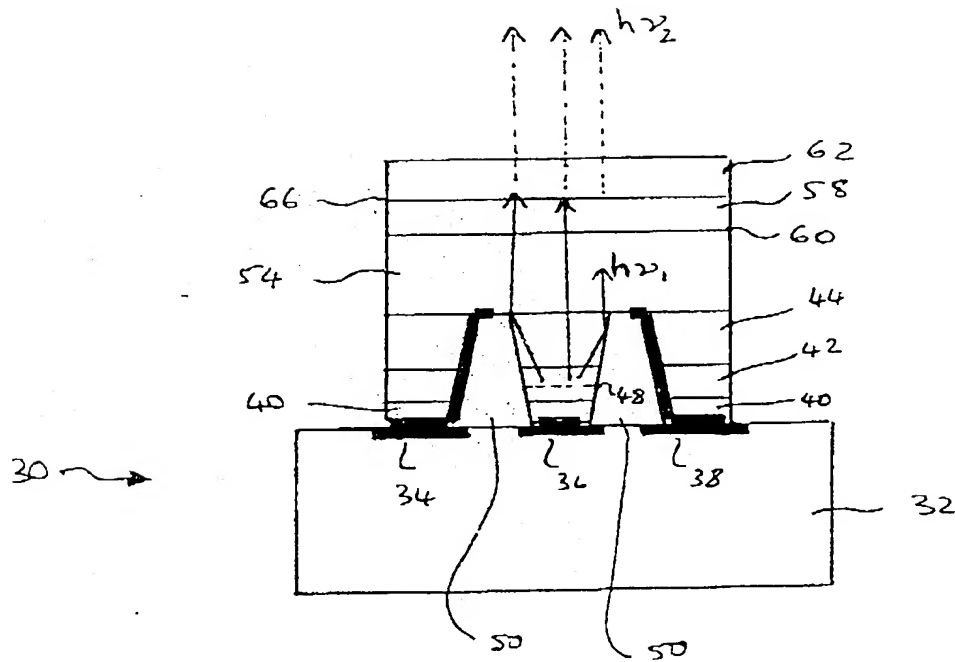


Figure 2

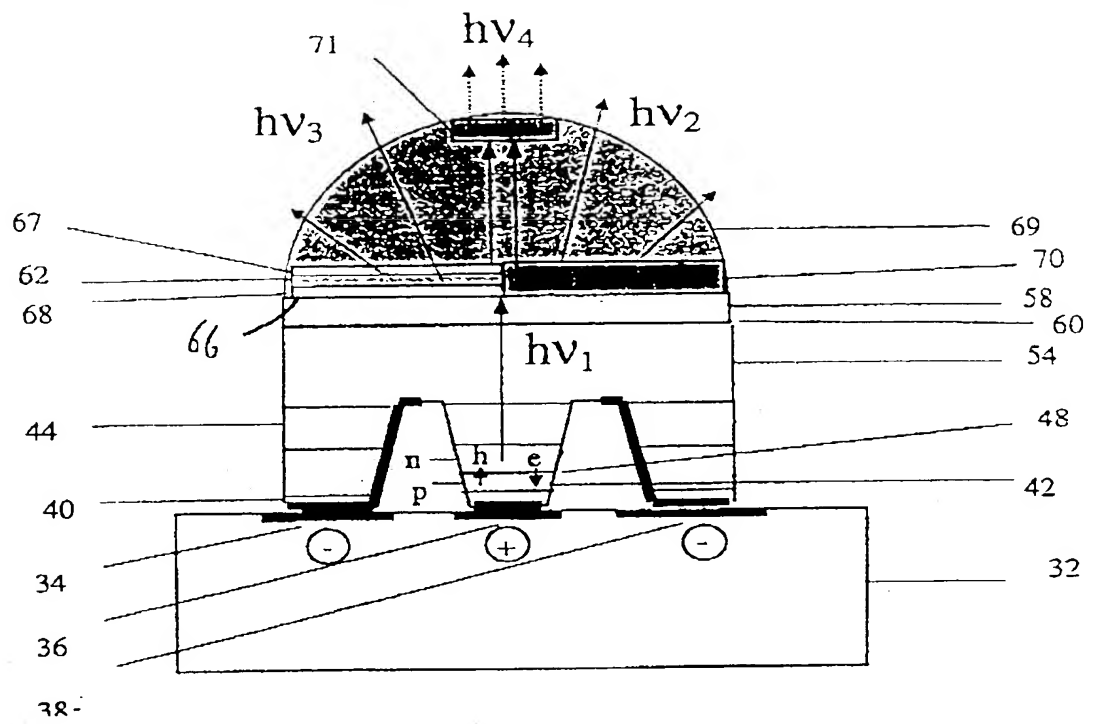
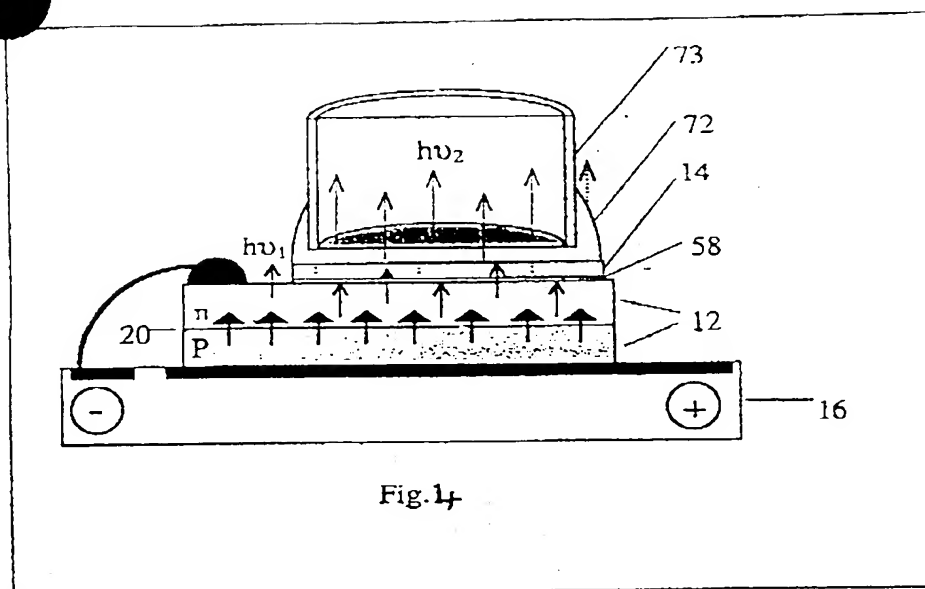


Fig 3





PCT/EP 00 / 0 3 7 4 5

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(РОСПАТЕНТ)**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

рег.No 20/12-262

"12" апреля 2000 г.

СПРАВКА

REC'D 28 JUL 2000

WIPO

PCT

Федеральный институт промышленной собственности Российского агентства по патентам и товарным знакам настоящим удостоверяет, что приложенные материалы являются точным воспроизведением первоначального описания, формулы и чертежей (если имеются) заявки на выдачу патента на изобретение N 99109287, поданной в апреле месяце 27 дня 1999 года (27.04.99).

Название изобретения

Полупроводниковый источник инфракрасного излучения (варианты)

ЗаявительФизико-технический институт
им. А.Ф.Иоффе РАН**Действительный автор(ы)**МАТВЕЕВ Борис Анатольевич
ЗОТОВА Нонна Вячеславовна
ИЛЬИНСКАЯ Наталья Дмитриевна
КАРАНДАШЕВ Сергей Аркадьевич
РЕМЕННЫЙ Максим Анатольевич
СТУСЬ Николай Матвеевич
ТАЛАЛАКИН Георгий Николаевич**PRIORITY DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)Уполномоченный заверить копию
заявки на изобретениеГ.Ф. Востриков
Заведующий отделом

Полупроводниковый источник инфракрасного излучения. (варианты)

Изобретение относится к области полупроводниковой оптоэлектроники, конкретно - к источникам инфракрасного (ИК) излучения и может найти применение в приборах газового анализа, спектрометрах, в системах обнаружения и связи.

Известен полупроводниковый источник ИК-излучения, содержащий активную область из материала A^3B^5 с заданной шириной запрещенной зоны и р-п переход [1], излучающий в средней ИК-области спектра. Источник выполнен на основе гетероструктуры $n\text{-InGaAs/p-InGaAs/n-InAs}$ и предназначен для измерения прозрачности фазы в области полосы поглощения углеводородов - 3.3мкм. Достоинствами источника являются большое время жизни (более 30000 часов) и узкий спектр излучения (менее 0.4мкм), что позволяет использовать его газоаналитической аппаратуре.

Недостатком является невозможность работы при повышенных температурах (не более 80 С).

Известен полупроводниковый источник ИК-излучения, взятый за прототип, содержащий активную область из материала A^3B^5 с заданной шириной запрещенной зоны и р-п переход [2], излучающий в ближней ИК-области спектра, который имеет возможность работы при повышенных температурах. Недостатком является отсутствие возможности работы в средней ИК-области спектра, где находятся основные (фундаментальные) полосы поглощения веществ и где эффективность работы анализаторов на основе таких источников особенно высока.

Задачей изобретения по п.1 является расширение диапазона излучения источника при повышенных температурах.

Задача решается созданием полупроводникового источника инфракрасного излучения, содержащего активную область из материала A^3B^5 и/или его твердых растворов с заданной шириной запрещенной зоны и р-п переход, в котором, согласно формуле изобретения, источник дополнительно содержит по меньшей мере одну оптически связанную с первой активной областью дополнительную активную область из материала A^3B^5 и/или его твердых растворов, причем ширина запре-

щенной зоны и толщина каждой последующей оптически связанной активной области удовлетворяют соотношениям:

$$h\nu_{\max} \leq E_{\text{посл.}} + E_f * k < E_{\text{пред.}}$$

$$1/\alpha_{\text{вх.}} \leq d \leq 1/\alpha_{\text{вых.}},$$

где $h\nu_{\max}$ - максимум спектра рекомбинационного излучения в последующей дополнительной активной области, оптически связанной с предыдущей активной областью,

$E_{\text{пред.}}$ - ширина запрещенной зоны предыдущей, оптически связанной с данной, активной области,

$E_{\text{посл.}}$ и E_f - ширина запрещенной зоны и энергия Ферми последующей оптически связанной дополнительной активной области, соответственно,

d - толщина последующей оптически связанной дополнительной активной области, $\alpha_{\text{вх.}}$ и $\alpha_{\text{вых.}}$ - эффективные коэффициенты поглощения для входящего и выходящего из последующей дополнительной активной области излучения, соответственно.

Задачей по п.2 является обеспечение возможности выбора длины волны излучения в широком диапазоне и упрощение технологии изготовления таких приборов за счет использования слоев большой толщины.

Эта задача решается тем, что в полупроводниковом источнике ИК-излучения по п.1 дополнительная активная область выполнена на основе варизонного материала, причем его узкозонная поверхность расположена со стороны р-п перехода.

Задачей по п.3 является повышение эффективности работы источника.

Эта задача решается тем, что в полупроводниковом источнике инфракрасного-излучения, содержащем активную область из материала A^3B^5 и/или его твердых растворов с заданной шириной запрещенной зоны и р-п переходом согласно формуле изобретения, источник дополнительно содержит по меньшей мере одну оптически связанную с первой активной областью дополнительную активную область из материала A^3B^5 и/или его твердых растворов, причем ширина запрещенной зоны и толщина каждой последующей оптически связанной активной области удовлетворяют соотношениям:

$$h\nu_{\max} \leq E_{\text{посл}} + E_f * k < E_{\text{пред}}$$

$$1/\alpha_{\text{пх.}} \leq d \leq 1/\alpha_{\text{вых.}},$$

и по меньшей мере между двумя оптически связанными активными областями введен слой вещества с коэффициентом преломления n , удовлетворяющим соотношению:

$$1 < n \leq n_{\text{пред., посл.}}$$

где $h\nu_{\max}$ - максимум спектра рекомбинационного излучения в последующей дополнительной активной области, оптически связанной с предыдущей активной областью,

$E_{\text{пред.}}$ - ширина запрещенной зоны предыдущей, оптически связанной с данной, активной области,

$E_{\text{посл.}}$ и E_f - ширина запрещенной зоны и энергия Ферми последующей оптически связанной дополнительной активной области, соответственно,

d - толщина последующей оптически связанной дополнительной активной области,

$\alpha_{\text{пх.}}$ и $\alpha_{\text{вых.}}$ - эффективные коэффициенты поглощения для входящего и выходящего из последующей дополнительной активной области излучения, соответственно,

$n_{\text{пред.}}$, $n_{\text{посл.}}$ - показатели преломления предыдущей и последующей активных областей, соответственно.

Задачей по п.4 является возможность выбора длины волны излучения источника по п.3 и упрощение технологии его изготовления.

Эта задача решается тем, что, в полупроводниковом источнике инфракрасного излучения по п.3 по меньшей мере одна дополнительная активная область выполнена на основе варизонного материала, причем его узкозонная поверхность расположена со стороны р-п перехода.

Сущность изобретения заключается в следующем.

Традиционный подход в создании источника в средней ИК-области состоит в том, что область инжекции и рекомбинации расположены в единой р-п или гетеро-р-п структуре. Разделив эти области, т.е. создав возможность инжекции в одном материале, а возможность рекомбинации в средней ИК-области - в другом, авторы обеспечили возможность свободы в выборе материала инжектора(р-п перехода).

Благодаря этому удалось сделать инжектор (р-п переход) в материале с большой шириной запрещенной зоны, что резко увеличило эффективность инжекции при повышенных температурах. При этом кажущаяся неэффективность, вызванная дополнительным фотопреобразованием квантов, сформированных в первой активной области, в кванты, излучаемые затем в последующей оптически связанной активной области через процесс поглощения и рекомбинации $h\nu_1 \rightarrow h\nu_2$, перекрывается выигрышем в эффективности инжекции. Это привело к новому эффекту - возможности эффективной работы источника в средней ИК-области при повышенных температурах.

Покажем существенность признаков.

Введение в конструкцию дополнительной активной области (хотя бы одной), оптически связанной с предыдущей, из материала A^3B^5 и/или его твердых растворов обеспечивает возможность преобразования длины волны излучения выходящего из предыдущей оптически связанной активной области в заданном диапазоне длин волн, поскольку материалы A^3B^5 имеют высокий коэффициент поглощения (порядка 10^4 см^{-1}), а также высокое значение внутреннего квантового выхода. Применение других веществ (например, A_2B_6) неэффективно, т.к. квантовый выход в них невелик и они менее стабильны, особенно при повышенных температурах. Выбор ширины запрещенной зоны дополнительной активной области (с учетом $k=0$ для невырожденного материала и $k=1$ для вырожденного) обеспечивает поглощение излучения, выходящего из предыдущей оптически связанной активной области.

Невыполнение условия $E_{\text{посл}} + E_g^* k < E_{\text{пред}}$ приведет к отсутствию фотовозбуждения носителей в дополнительной активной области в силу резкого снижения коэффициента поглощения при энергиях, меньших $(E_{\text{посл}} + E_g^* k)$. Область применения предлагаемого источника определяет величину $h\nu_{\text{max}}$, которая обычно совпадает с полосой поглощения анализируемых веществ, поэтому необходимо согласование заранее заданного параметра $h\nu_{\text{max}}$ с шириной запрещенной зоны дополнительной оптически связанной активной области, т.е. $h\nu_{\text{max}} \leq E_{\text{посл}} + E_g^* k$. При невыполнении этого условия излучение, выходящее из дополнительной активной области, не будет совпадать по параметрам с требованиями аналитической задачи. Выполнение

условия $d \geq 1/\alpha_{\text{вх}}$ обеспечивает поглощение большей части излучения, выходящего из предыдущей оптически связанной активной области. При $d < 1/\alpha_{\text{вх}}$ в дополнительной активной области поглощается менее приблизительно 2/3 общего потока ближнего ИК-излучения ($I = I_0 \exp(-\alpha d)$), что приведет к снижению эффективности преобразования (мощности) излучения и невозможности использования источника для практики. Выполнение условия $d \leq 1/\alpha_{\text{вых}}$ необходимо для эффективного вывода излучения среднего ИК диапазона из дополнительной активной области. При невыполнении этого условия большая часть излучения будет вновь поглощаться в дополнительной активной области, и интенсивность выходящего излучения будет снижаться, приводя к непригодности источника.

По п.2: создание дополнительной активной области в виде варизонного материала A^3B^5 и/или его твердых растворов позволяет решать задачу получения набора источников с разными длинами волн. т.к. послойное стравливание (или рост) позволяет получать материал с требуемой шириной запрещенной зоны. При расположении узкозонной поверхности со стороны р-п перехода резко снижается эффективный коэффициент поглощения $\alpha_{\text{вых}}$, т.к. широкозонные области варизонного материала обладают эффектом "окна" для излучения, сформированного в узкозонной части. Расчет $\alpha_{\text{вых}}$ для варизонного материала приведен в [3,4]. Таким образом, появляется возможность использовать достаточно толстые слои (около 60 мкм, $\nabla E_g = 2 \text{ М эВ/мкм}$), что, учитывая хрупкость материалов A^3B^5 , обеспечивает упрощение технологии производства приборов. Расположение узкозонной поверхности со стороны выходящего излучения (т.е. расположение широкозонной поверхности со стороны р-п перехода) приведет к существенному снижению эффективности источника из-за поглощения выходящего света.

По п.3: введение в конструкцию дополнительных оптически связанных с первой активными областей из материала A^3B^5 и/или их твердых растворов, с удовлетворяющими определенным соотношениям шириной запрещенной зоны и шириной, и заполнение промежутка между активными областями (введение слоя вещества) веществом с коэффициентом преломления n , удовлетворяющим условию $1 < n \leq n_{\text{пред.посл.}}$, где $n_{\text{пред.}}$ и $n_{\text{посл.}}$ - показатели преломления оптически связанных активных областей, приводит к созданию р-п перехода (инжектора) в материале с

большой шириной заштрихованной зоны, чем резко увеличивает эффективность инжекции при повышенных температурах, а также снижает потери мощности получаемого в средней ИК области при повышенных температурах излучения, поскольку увеличивает угол полного внутреннего отражения на границе предыдущей и последующей оптически связанных активных областей, что приводит к повышению эффективности работы источника.

По п.4: выполнение дополнительной активной области на основе варизонного материала с расположением его узкозонной поверхности со стороны р-п перехода позволяет получить эффективно работающий источник ИК излучения, имеющий возможность излучать различные длины волн и достаточно простой в изготовлении.

Предлагаемое устройство схематически изображено на Фиг.1, где:

- 1 - первая активная область,
- 2 - р-п переход,
- 3 - дополнительная активная область,
- 4 - держатель.

Работа устройства.

На р-п переход подают прямое смещение, инициирующее инжекцию носителей в первую активную область. Инжектированные носители рекомбинируют с выделением излучения в ближней ИК области спектра с энергией $h\nu \cong E_{\text{прел}}$. Сформированные таким образом кванты покидают первую активную область и попадают в последующую, дополнительную, оптически связанную с первой, активную область, где поглощаются вблизи поверхности, обращенной к р-п переходу. В результате во второй области формируются неосновные, фотовозбужденные носители, которые в свою очередь, рекомбинируют с энергией, близкой к $E_{\text{полс.1}} + E_{\Gamma}^* \kappa$, где $\kappa=0$ для невырожденного материала и $\kappa=1$ - для вырожденного. Полученные таким образом кванты, соответствующие среднему ИК-диапазону спектра, покидают дополнительную активную область и создают поток излучения, пригодный для практического применения.

Предлагаемый источник ИК-излучения (пример оптимального для практики варианта) схематически изображен на Фиг.2, где:

- 1 - первая активная область,
- 2 - p-n переход,
- 3 - дополнительная активная область,
- 4 - держатель,
- 5 - узкозонная поверхность варизонного материала,
- 6 - широкозонная поверхность варизонного материала,
- 7 - оптический компаунд,
- 8 - подложка,
- 9 - ограничивающий слой,
- 10 - эмиттер

Пример 1. Излучатель был создан в Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе РАН, для чего методом жидкофазной эпитаксии на подложке $n^+-\text{InP}$ (Sn), ориентированной по плоскости (100), были выращены следующие слои: 1) n - InGaAsP (нелегированный) с $E_g = 1.19 \text{ eV}$ и толщиной $d \sim 1.0 \text{ мкм}$, 2) n - InGaAsP (нелегированный) слой ($E_g = 1.01 \text{ eV}$, $d \sim 0.4 \text{ мкм}$), 3) p^+ - InGaAsP (легированный Zn, $E_g = 1.01 \text{ eV}$, $d \sim 4.7 \text{ мкм}$). Состав слоя 2 был оптимизирован для получения излучения в области 1.21-1.23 мкм при комнатной температуре. Эпитаксиальная структура раскалывалась на чипы размерами $1 \times 1 \times 0.35 \text{ мм}^3$, которые монтировались (припаивались индием) на стандартный держатель ТО-18 р-слоем вниз. n -контакт формировался на поверхности InP индием так, что свободная поверхность InP имела размеры $1 \times 0.9 \text{ мм}^2$. В качестве второго активного слоя использовался арсенид индия толщиной 2-4 мкм n -типа проводимости с $n = 2 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$. Слой укреплялся на поверхности $n^+-\text{InP}$ (Sn) с помощью точечной припайки индием. Полученный таким образом источник запитывался постоянным током 30 мА и излучал на длине волны 3.8 мкм с полушириной спектра излучения 0.4 мкм. Излучение регистрировалось вплоть до температур 130 С, при этом максимум спектра смещался в длинноволновую сторону и составлял 3.9 мкм.

Пример 2. Эпитаксиальная структура для первой активной области создавалась аналогично описанной в примере 1. Методами стандартной фотолитографии на эпитаксиальной структуре создавалась глубокая меза диаметром 400 мкм, на которую напылялся омический контакт (Cr+Au) диаметром 260 мкм. Контакт к n -области (Cr+Au) имел форму подковы и напылялся как на p -область вне мезы

так и на n -область на скандалах внешней мезы. После напыления контакты усиливались за счет дополнительного осаждения гальванического золота. Кристаллы с меза структурами и контактами разрезались на чипы размером $0.9 \times 1 \text{ мм}^2$ и монтировались на носитель из полуизолирующего кремния, имеющий контактные площадки $\text{Sn}+\text{Pb}$, как это показано в [5]. Узкозонная активная область создавалась следующим образом. На подложке арсенида индия выращивался градиентный слой твердого раствора InAsSbP толщиной 60 мкм с составом на поверхности $\text{InAs}_{0.92}\text{Sb}_{0.08}$ и возрастанием содержания фосфора к подложке с градиентом ширины запрещенной зоны $1\text{-}2 \text{ мэВ/мкм}$. После выращивания подложка химически травливалась, при этом окончательная толщина слоя была 20 мкм . Полученный градиентный слой прикреплялся точечной пайкой индием узкозонной поверхностью к подложке InP . Изготовленный описанным выше образом излучатель излучал на длине волны 4.3 мкм вблизи полосы поглощения углекислого газа и показывал стабильную работу вплоть до 90 C .

Пример 3. Источник излучения изготавливался также, как описано в примере 2, однако промежуток между подложкой InP и слоем InAsSbP заполнялся оптическим полимерным компаундом, прозрачным в ближней ИК области, как показано на Фиг.2. Мощность излучения источника была в $2\text{-}3$ раза выше, чем в примере 2.

Пример 4. Источник излучения изготавливался так, как описано в примере 1, однако вторая активная область располагалась перпендикулярно $p\text{-}n$ переходу и параллельно (011) сколам кристалла. $P\text{-}n$ переход запитывался короткими импульсами (менее 1 мкс) с амплитудой тока 7 А . Мощность излучения была более, чем на порядок выше, чем в примере 2, благодаря началу стимулированного режима работы первой активной области.

Пример 5. Источник создавался так, как описано в примере 3, однако площадь InAsSbP -слоя была в 2 раза меньше, а освободившаяся на поверхности InP площадь была покрыта слоем InAs , аналогичным описанным в примере 1. Полученный источник излучал одновременно на двух длинах волн: 4.3 мкм и 3.8 мкм .

Пример 6. Первая активная область и $p\text{-}n$ переход выполнены так же как и в предыдущих примерах. На поверхности InP размещали две дополнительные актив-

ные области, состоящие из градиентных слоев $\text{InAs}_{1-x-y}\text{Sb}_x\text{P}_y$ и $\text{In}_{1-v}\text{Ga}_v\text{As}_{1-w}\text{Sb}_w$ с составами на узкозонной поверхности: $x=0,2$, $y=0$, $v=0,1$, $w=0,1$. Дополнительные активные области имели на плоскости прямоугольную форму и были плотно пристыкованы друг к другу по линии, условно делящей поверхность InP на две равные части. При подаче напряжения на р-п переход источник излучал на двух длинах волн - 5,5 мкм и 3,8 мкм, соответствующих фотопреобразованию в двух активных дополнительных областях. Подобные двух- и более волновые источники могут использоваться в оптических газоанализаторах в схемах с несколькими каналами измерений.

Пример 7. Излучатель имел те же составные части, что и в примере 5, однако дополнительные активные области располагались последовательно по ходу луча, причем дополнительная область из InGaAsSb была присоединена к InP с помощью компаунда, а вторая дополнительная область из InAsSbP была расположена от InGaAsSb на расстоянии 10 мм. Такое расположение областей позволило получить луч с последовательно меняющейся длиной волны (от 3,8 до 5,5 мкм), что может использоваться в спектроскопии.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] B.Matveev et al, *Sensors & Actuators*, Vol. 51(1998), Nos. 1-3, pp. 233-237
- [2] Zh.I.Alferov, *III-V Review*, Vol.11 (1998), No 1, pp.26-31.
- [3] А.Берг, П.Дин, "Светодиоды", "Мир", Москва, 1979, стр.578
- [4] N.P.Esina et , *Sov.Phys.Semicond.* Vol 15(1981), N 12, pp.1372-1374.
- [5] B.Matveev et al, *IEE Proceedings*, Vol 145 (1998), No (5), pp. 254-256

Формула группы изобретений.

1. Полупроводниковый источник инфракрасного излучения, содержащий активную область из материала A^3B^5 и/или его твердых растворов с заданной шириной запрещенной зоны и р-п переход, отличающийся тем, что, источник дополнительно содержит по меньшей мере одну оптически связанную с первой активной областью дополнительную активную область из материала A^3B^5 и/или его твердых растворов, причем ширина запрещенной зоны и толщина каждой последующей оптически связанной активной области удовлетворяют соотношениям:

$$h\nu_{max} \leq E_{посл.} + E_f * k < E_{пред.}$$

$$1/\alpha_{inx.} \leq d \leq 1/\alpha_{вых.}, \text{ где}$$

$h\nu_{max}$ - максимум спектра рекомбинационного излучения в последующей дополнительной активной области, оптически связанной с предыдущей активной областью,

$E_{пред.}$ - ширина запрещенной зоны предыдущей, оптически связанной с данной, активной области,

$E_{посл.}$ и E_f - ширина запрещенной зоны и энергия Ферми последующей оптически связанной дополнительной активной области, соответственно,

$k = 0; 1$ - коэффициент для невырожденного и вырожденного материала, соответственно.

d - толщина последующей оптически связанной дополнительной активной области

$\alpha_{inx.}$ и $\alpha_{вых.}$ - эффективные коэффициенты поглощения для входящего и выходящего из последующей дополнительной активной области излучения, соответственно.

2. Полупроводниковый источник по п.1, отличающийся тем, что, по меньшей мере одна дополнительная активная область выполнена на основе варизонного материала, причем его узкозонная поверхность расположена со стороны р-п перехода.

3. Полупроводниковый источник инфракрасного излучения, содержащий активную область из материала A^3B^5 и/или его твердых растворов с заданной шириной запрещенной зоны и р-п переход, отличающийся тем, что, источник дополнительно содержит по меньшей мере одну оптически связанную с первой активной областью дополнительную активную область из материала A^3B^5 и/или его твердых растворов, причем ширина запрещенной зоны и толщина каждой последующей оптически связанной активной области удовлетворяют соотношениям:

$$h\nu_{max} \leq E_{посл.} + E_f * \kappa < E_{пред.}$$

$$1/\alpha_{вх.} \leq d \leq 1/\alpha_{вых.},$$

и по меньшей мере между двумя оптически связанными активными областями введен слой вещества с коэффициентом преломления n , удовлетворяющим соотношению

$$1 < n \leq n_{пред. посл.},$$

где $h\nu_{max}$ - максимум спектра рекомбинационного излучения в последующей дополнительной активной области, оптически связанной с предыдущей активной областью, $E_{пред.}$ - ширина запрещенной зоны предыдущей, оптически связанной с данной, активной областью,

$E_{посл.}$ и E_f - ширина запрещенной зоны и энергия Ферми последующей оптически связанной дополнительной активной области, соответственно,

$\kappa = 0, 1$ - коэффициент для невырожденного и вырожденного материала, соответственно,

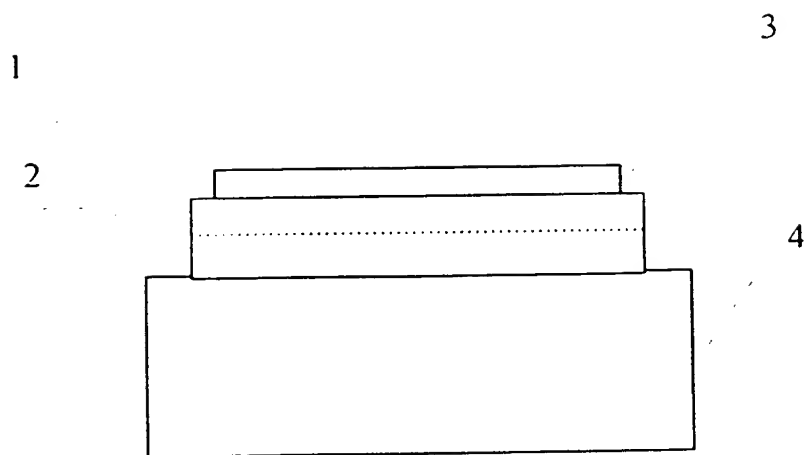
d - толщина последующей оптически связанной дополнительной активной области,

$\alpha_{вх.}$ и $\alpha_{вых.}$ - эффективные коэффициенты поглощения для входящего и выходящего из последующей дополнительной активной области излучения, соответственно,

$n_{пред.}$, $n_{посл.}$ - показатели преломления предыдущей и последующей активных областей, соответственно.

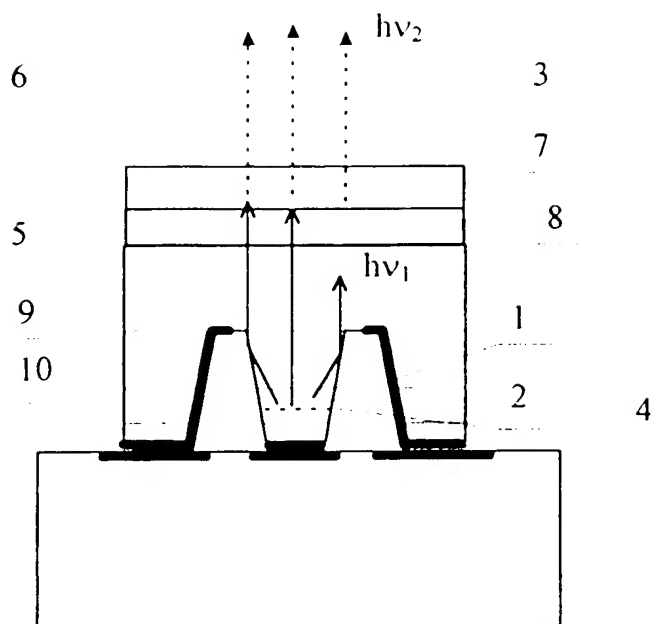
4. Полупроводниковый источник по п.3, отличающийся тем, что, по меньшей мере одна дополнительная активная область выполнена на основе варизонного материала, причем его узкозонная поверхность расположена со стороны р-п перехода.

Полупроводниковый источник
инфракрасного излучения.



Фиг.1

Полупроводниковый источник
инфракрасного излучения.



Фиг.2

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ИСТОЧНИК ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
(варианты)

Изобретение относится к области полупроводниковой оптоэлектроники и может найти применение в приборах газового анализа, спектрометрах, системах связи. Задачей предлагаемого изобретения по п.1 является расширение диапазона излучения источника при повышенных температурах. Задача решается введением в источник инфракрасного излучения, содержащий активную область из материала А В³ и/или его твердых растворов с заданной шириной запрещенной зоны и р-п переход, по меньшей мере одной дополнительной активной области из тех же материалов, что и первая, при этом ширина запрещенной зоны и толщина каждой последующей оптической связанной активной области удовлетворяют определенным соотношениям. По п.2 решается дополнительно задача возможности выбора длины волны излучения в широком диапазоне и упрощение технологии изготовления источника - за счет того, что в источнике по п.1 дополнительная (по меньшей мере одна) активная область выполнена на основе варизонного материала, причем его узкозонная поверхность расположена со стороны р-п перехода. В варианте полупроводникового источника инфракрасного излучения по п.3 решается задача повышения эффективности работы источника за счет того, что, помимо введения дополнительных активных областей (по меньшей мере одной) с определенными параметрами (шириной запрещенной зоны и толщиной) по меньшей мере между двумя оптически связанными активными областями введен слой вещества с определенным коэффициентом преломления. Для возможности выбора длины волны излучения и упрощения технологии изготовления источника в нем по п.4 по меньшей мере одна дополнительная активная область выполнена на основе варизонного материала, так что его узкозонная поверхность расположена со стороны р-п перехода.

2 сам.п.ф-лы, 2 зав.п.ф-лы, 2 илл.